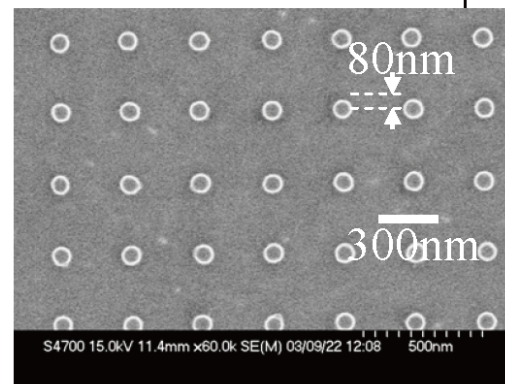
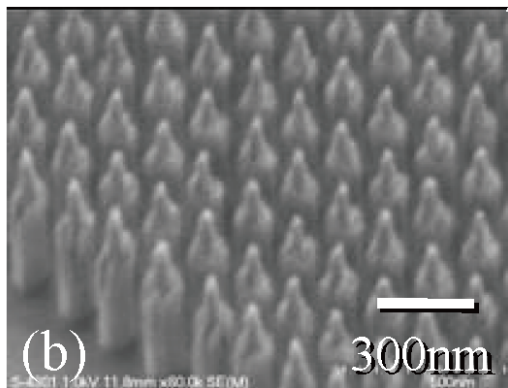
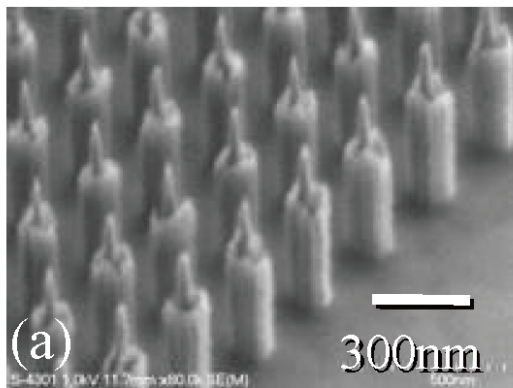


## 極微細加工・造形 共同研究支援例 住友電工(株) 高輝度ダイヤモンドナノエミッタの開発

**細さ、密度共に世界初**

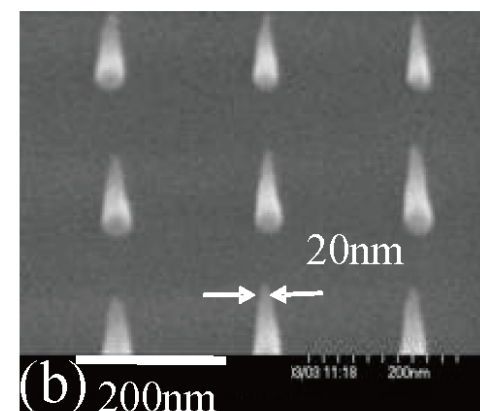
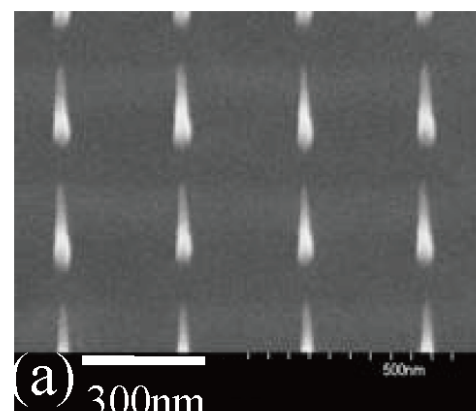
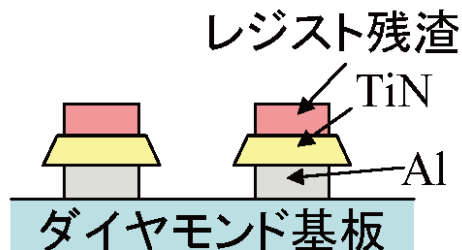
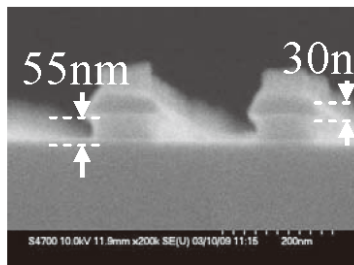
(住友電工への共同研究支援: F広大H15-012)



a-Siマスク平面図

TiN / Alマスクにより形成したローソク型ダイヤモンドナノ突起

(a)300nm間隔、(b)200nm間隔



a-Siマスクにより形成したニードル型ダイヤモンドナノ突起

(a)300nm間隔、(b)200nm間隔

TiN/Alマスク断面図